

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第7部門第2区分
 【発行日】平成26年9月18日(2014.9.18)

【公表番号】特表2014-509446(P2014-509446A)
 【公表日】平成26年4月17日(2014.4.17)
 【年通号数】公開・登録公報2014-019
 【出願番号】特願2013-547532(P2013-547532)
 【国際特許分類】

H 0 1 L 21/683 (2006.01)

H 0 1 L 21/265 (2006.01)

H 0 1 J 37/20 (2006.01)

H 0 1 J 37/317 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/68 R

H 0 1 L 21/265 6 0 3 D

H 0 1 J 37/20 E

H 0 1 J 37/20 A

H 0 1 J 37/317 B

【誤訳訂正書】

【提出日】平成26年8月4日(2014.8.4)

【誤訳訂正1】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0003

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0003】

図1 aは、ベース12と加熱ブロック14とが互いに結合される従来技術に係る静電クランプ10の構成を示す。静電クランプ10は加熱ブロック14により支持される基板を抵抗加熱するのに用いられ得る加熱器(図示せず)を含む。静電クランプ10は基板に対し1以上の処理を行う低圧力チャンバなどの処理チャンバ内の基板ホルダとして動作してもよい。そのような低圧力チャンバの例としては、例えば基板の処理の前に 10^{-7} トル以下の圧力へ減圧を行い、 $10^{-7} \sim 10^0$ トルの範囲の環境ガス圧において動作し得るプラズマおよびイオンビームツールが挙げられる。